

【公報種別】特許法第 17 条の 2 の規定による補正の掲載

【部門区分】第 2 部門第 4 区分

【発行日】平成25年11月21日 (2013.11.21)

【公開番号】特開2013-208819(P2013-208819A)

【公開日】平成25年10月10日 (2013.10.10)

【年通号数】公開・登録公報2013-056

【出願番号】特願2012-80869(P2012-80869)

【国際特許分類】

B 3 2 B 9/00 (2006.01)

B 3 2 B 27/36 (2006.01)

B 6 5 D 65/40 (2006.01)

B 6 5 D 81/24 (2006.01)

【F I】

B 3 2 B 9/00 A

B 3 2 B 27/36

B 6 5 D 65/40 D

B 6 5 D 81/24 D

【手続補正書】

【提出日】平成25年8月9日 (2013.8.9)

【手続補正 1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】全文

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項 1】

ポリエチレンテレフタレート樹脂フィルムからなる基材と、該基材の少なくとも一方の面に形成された酸化珪素薄膜を有し、前記ポリエチレンテレフタレート樹脂フィルムは、位相差測定法により測定される分子鎖の配向角がMD方向に対して50°から90°または、-50°から-90°の範囲であり、前記酸化珪素薄膜は、X線光電子分光法によって算出される酸素と珪素の比(O/Si)が1.6~2.0の範囲内であることを特徴とするガスバリア積層体。

【請求項 2】

前記酸化珪素薄膜の膜厚は、5~300nmであることを特徴とする請求項1に記載のガスバリア積層体。

【請求項 3】

前記基材と前記酸化珪素薄膜との間にアンカーコート層をさらに有することを特徴とする請求項1または2に記載のガスバリア積層体。

【請求項 4】

前記アンカーコート層の材質は、ポリエステル樹脂、ウレタン樹脂、アクリル系樹脂及びオキサゾリン基含有樹脂から選択されることを特徴とする請求項3に記載のガスバリア積層体。

【請求項 5】

前記酸化珪素薄膜が積層された前記基材の面は、リアクティブイオンエッチング処理による下地層が形成されていることを特徴とする請求項1または2に記載のガスバリア積層体。

【請求項 6】

前記リアクティブイオンエッチング処理は、アルゴン、窒素、酸素、および水素からな

る群から選択される少なくとも１種類のガスを用いて行われる処理であることを特徴とする請求項５に記載のガスバリア積層体。

【請求項７】

位相差測定法により測定される配向角がＭＤ方向に対して５０°から９０°または－５０°から－９０°であるポリエチレンテレフタレート樹脂フィルムを基材として選択する工程と、前記基材の少なくとも一方の面に、Ｘ線光電子分光法によって算出される酸素と珪素の比（ O/Si ）が１．６～２．０の範囲内である酸化珪素薄膜を積層する工程とを含むことを特徴とするガスバリア積層体の製造方法。